日本国特許庁

PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT 29.08.00

REGD 12 SEP 2000

WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2000年 7月 7日

JP00105229

出 願 番 号 Application Number:

特願2000-206304

E KU

出 類 人 Applicant (s):

住友化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 7月28日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office





特2000-206304

【書類名】

特許願

【整理番号】

P151724

【提出日】

平成12年 7月 7日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B01J 37/00

C01B 7/04

【発明者】

【住所又は居所】

茨城県つくば市北原 6 住友化学工業株式会社内

【氏名】

濱松 浩

【発明者】

【住所又は居所】

千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工業株式会社内

【氏名】

関 航平

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県市原市姉崎海岸5の1 住友化学工業株式会社内

【氏名】

日比 卓男

【特許出願人】

【識別番号】 000002093

【氏名又は名称】

住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】

06-6220-3404

【選任した代理人】

【識別番号】

100094477

【弁理士】

【氏名又は名称】

神野 直美

【電話番号】

06-6220-3404

【選任した代理人】

【識別番号】

100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】

06-6220-3404

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成11年特許願第222293号

【出願日】

平成11年 8月 5日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

010238

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9903380

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 担持酸化ルテニウム触媒の製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】担持酸化ルテニウム触媒が下記の工程を含む調製方法により調製された触媒である、担持酸化ルテニウム触媒の製造方法。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物を触媒担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上の温度で、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成する工程

ヒドラジン処理工程:焼成工程で得られたものをヒドラジンとアルカリの混合 溶液で処理する工程

酸化工程:ヒドラジン処理工程で得られたものを酸化する工程

【請求項2】ルテニウム化合物を触媒担体に担持後、ルテニウム化合物を担体に担持したそのものを、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成して、担持酸化ルテニウム触媒を製造する方法であって、製造された該触媒および該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒についてそれぞれ、下記の広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)法で測定して得られたピーク強度比率の値をA(b)、B(b)とし、下記式(1)を充足する触媒である、担持酸化ルテニウム触媒の製造方法。

広域 X線吸収微細構造解析 (EXAFS) 法:触媒 bを X線吸収微細構造解析 (XAFS) 法で測定する。その際に X線吸収スペクトルから求められる Ru-K吸収端の広域 X線吸収微細構造 (EXAFS) スペクトルをフーリエ変換して得られた動径分布関数において 0.32 nm付近のピーク強度から求められる二酸化ルテニウム中のルテニウム原子の第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度を分子とし、粒子径 10 nm以上の二酸化ルテニウムの場合のピーク強度を分母とし、ピーク強度比率を求める。

【数1】

 $1 \le B \ (b) / A \ (b) \le 1.45$ (1)

ただしA(b)≦0.8

A(b):製造された該触媒bについてEXAFS法によって求めたピーク強

度比率。

B(b):製造された該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した 触媒 b について E X A F S 法によって求めたピーク強度比率。以下に50時間反 応テストの方法を示す。すなわち、担持酸化ルテニウム触媒 a および b を反応管 の入口からを順に充填する。このとき、触媒 a および b の充填比率は質量比で1 :10とする。次ぎに、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水 素ガスを0.185~0.197mol/g-cat・h流通させ、同時に、酸 素ガスを0.092~0.098mol/g-cat・h流通させ、触媒 b のホットスポットを360±1℃に保ちながら50時間、反応を行う。反応後、触媒 b について E X A F S 法によって求めたピーク強度比率。ここで、触媒 a は、塩 化水素を酸素によって酸化して塩素を生成する反応において、塩化水素と酸素の モル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生 成活性が、2×10⁻⁴~3×10⁻⁴mol/min・gー触媒である担持酸化ル テニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウ ム触媒である。

【請求項3】触媒が、担体にルチル結晶形を含有する酸化チタンを用いた触 媒である請求項1または請求項2記載の製造方法。

【請求項4】担持酸化ルテニウム触媒が下記の工程を含み、ヒドラジン処理 工程を含まない調製方法により調製された触媒である、担持酸化ルテニウム触媒 の製造方法。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物をルチル結晶形を含有する酸化 チタン担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600 ℃以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還 元性ガス中で焼成する工程

【請求項5】担持酸化ルテニウム触媒が下記の工程を含み、ヒドラジン処理工程を含まない調製方法により調製された触媒であって、製造された該触媒および該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒についてそれぞれ、下記の触媒活性試験方法で測定して得られた値をC(b)、D(b)とし、下

記式 (2) を充足する触媒である、請求項4記載の製造方法。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物をルチル結晶形を含有する酸化 チタン担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600 ℃以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還 元性ガス中で焼成する工程

触媒活性試験方法:触媒2.3~2.5gを2mm球の市販のαーアルミナ担体10~20gとよく混合することにより触媒を希釈して石英製反応管(内径12mm)に充填し、塩化水素ガスを190~210m1/min、酸素ガスを190~210m1/min、酸素ガスを190~210m1/min、酸素ガスを150~210m1/min(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給する。石英反応管を電気炉で加熱し、内温(ホットスポット)を300±1℃とする。反応開始2.0±1.0時間後の時点で、反応管出口のガスを30質量%ヨウ化カリウム水溶液に流通させることによりサンプリングを行い、ヨウ素滴定法及び中和滴定法によりそれぞれ塩素の生成量及び未反応塩化水素量を測定する。次の式で求められた単位触媒質量当りの塩素生成活性を触媒活性とする。

単位触媒質量当りの塩素生成活性 (mol/min・gー触媒) =単位時間当りの出口塩素生成量 (mol/min)/触媒質量 (g)

【数2】

0. $79 \le D(b) / C(b) \le 1$ (2)

ただし3. 0×10⁻⁴mol/min·g-触媒≦C(b)

C (b): 触媒 b について触媒活性試験方法によって求めた触媒活性。

D(b):以下に50時間反応テストの方法を示す。すなわち、担持酸化ルテニウム触媒 a および b を反応管の入口からを順に充填する。このとき、触媒 a および b の充填比率は質量比で1:10とする。次ぎに、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水素ガスを0.185~0.197mol/g-cat・h流通させ、同時に、酸素ガスを0.092~0.098mol/g-cat・h流通させ、触媒 b のホットスポットを360±1℃に保ちながら50時間、反応を行う。D(b)は、反応後、触媒 b について触媒活性試験方法によって求めた触媒活性。ここで、触媒 a は、塩化水素を酸素によって酸化して塩素を

生成する反応において、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生成活性が、 $2\times10^{-4}\sim3\times10^{-4}$ の 1 / m i n · g - 触媒である担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、塩化水素を酸素によって酸化する塩素の製造等において用いる担持酸化ルテニウム触媒の製造方法に関する。更に詳しくは、本発明は、担持酸化ルテニウム触媒の製造方法であって、活性の高い触媒を製造できる方法であり、より少量の触媒でより低い反応温度で目的物質を製造できる活性の高い、また反応中にシンタリングの少ない、かつ、調製工程が簡便であり、触媒活性低下の少ない触媒の製造が可能な担持酸化ルテニウム触媒の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

担持酸化ルテニウム触媒の製造方法について説明するが、酸化ルテニウム触媒は塩化水素の酸化反応による塩素の製造法の触媒として有用であり、塩化ルテニウムを加水分解し、酸化し、焼成して得られることが知られている。たとえば、特開平9-67103号公報ではルテニウム化合物をアルカリ金属水酸化物で加水分解した後、水酸化チタンに担持し空気焼成することによって酸化チタンに担持した酸化ルテニウム触媒が得られることが記載されている。

また、本発明者らは、担持金属ルテニウム触媒を酸化することによって担持酸 化ルテニウム触媒が得られることを見いだしている。

担持金属ルテニウム触媒としては、たとえば、塩化ルテニウムを担体に担持して乾燥した後、水素気流中で加熱して担持金属ルテニウム触媒を調製する方法が知られている。しかし、塩化ルテニウムを水素で還元した場合は、ルテニウムのシンタリングが生じるので、水素還元触媒を酸化して調製した担持酸化ルテニウム触媒は活性が低いという問題点があった。

[0003]

工業的には触媒の活性が高いことと、触媒に含有される単位ルテニウム質量あたりの活性が高いことの両方が要求される。触媒に含有される単位ルテニウム質量あたりの活性が高いことによって、触媒に含有されるルテニウムの量を少なくできるのでコスト的には有利になる。一般的には、活性の高い触媒を用い、より低温で反応を行うことによってより有利な反応条件を選ぶことができる。また、触媒の安定性の面でもより低温で反応を行うことが好ましい。さらに、工業的には触媒活性の低下が起こりにくい触媒が望まれる。触媒活性の経時変化を測定したときに、より低下率の少ない触媒が好ましい。つまり、寿命の長い触媒が要求される。

[0004]

従来は担体に担持したルテニウム化合物、特にハロゲン化ルテニウムをヒドラジンのアルカリ溶液で処理することによって活性の高い触媒を製造することができたが、担体に担持したルテニウム化合物、特にハロゲン化ルテニウムをヒドラジンのアルカリ溶液で処理する前に焼成などの方法によって担体に固定化することがさらに高活性な触媒の開発につながる方法として望まれていた。また、さらに、触媒上に担持された酸化ルテニウムが反応中にシンタリングして活性が低下するという問題があった。そこで、反応中に酸化ルテニウムがシンタリングしない触媒が望まれていた。触媒調製工程は短い方が好ましく、簡便に高性能の触媒を調製できることが望まれていた。また、さらに、担体にルチル結晶形を含有する酸化チタンを用いることが、さらに高活性な触媒とならないか検討が望まれていた。一般的には、反応中に触媒の活性が低下するという問題があった。反応中に活性低下の少ない触媒の開発が望まれていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、より少量の触媒でより低い反応温度で目的物質を製造できる活性の高い、また反応中にシンタリングの少ない、かつ、調製工程が簡便である触媒を製造可能とし、さらには当該反応において、活性低下の少ない触媒の製造を可能とする担持酸化ルテニウム触媒の製造方法を提供することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、前述の課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ルテニウム化合物を触媒担体に担持後、焼成して得られるものを、ヒドラジン処理して酸化するか、ヒドラジン処理せずに、広域X線吸収微細構造解析(EXAFS; Extended X-ray Absorption Fine Structure) 法にて測定した値が特定の条件を充足した時、もしくは担体にルチル結晶形を含有する酸化チタンを用いた該触媒を用いてその触媒を特定の触媒活性試験方法にて測定した値が特定の条件を充足した時に、上記の課題を解決できる優れた触媒が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。

[0007]

すなわち、本発明のうち第一の発明は、担持酸化ルテニウム触媒が下記の工程 を含む調製方法により調製された触媒である、担持酸化ルテニウム触媒の製造方 法に係るものである。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物を触媒担体に担持する工程 焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上の温度 で、不活性ガス中、酸化性ガス中又は還元性ガス中で焼成する工程

ヒドラジン処理工程:焼成工程で得られたものをヒドラジンとアルカリの混合 溶液で処理する工程

酸化工程:ヒドラジン処理工程で得られたものを酸化する工程

[0008]

また、本発明のうち第二の発明は、ルテニウム化合物を触媒担体に担持後、ルテニウム化合物を担体に担持したそのものを、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成して、担持酸化ルテニウム触媒を製造する方法であって、製造された該触媒および該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒についてそれぞれ、下記の広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)法で測定して得られたピーク強度比率の値をA(b)、B(b)とし、下記式(1)を充足する触媒である、担持酸化ルテニウム触媒の製造方法に係わるものである。

広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)法:触媒bをX線吸収微細構造解析(XAFS; X-ray Absorption Fine Structur

e) 法で測定する。その際にX線吸収スペクトルから求められるRuーK吸収端の広域X線吸収微細構造(EXAFS)スペクトルをフーリエ変換して得られた動径分布関数においてO.32nm付近のピーク強度から求められる二酸化ルテニウム中のルテニウム原子の第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度を分子とし、粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムの場合のピーク強度を分母とし、ピーク強度比率を求める。

[0009]

【数3】

 $1 \le B \ (b) / A \ (b) \le 1.45$ (1)

[0010]

ただしA(b)≦0.8

A (b):製造された該触媒 b について E X A F S 法によって求めたピーク強度比率。

B(b):製造された該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した 触媒 b についてE X A F S 法によって求めたピーク強度比率。以下に50時間反応テストの方法を示す。すなわち、担持酸化ルテニウム触媒 a および b を反応管の入口からを順に充填する。このとき、触媒 a および b の充填比率は質量比で1:10とする。次ぎに、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水素ガスを0.185~0.197mol/g-cat・h流通させ、同時に、酸素ガスを0.092~0.098mol/g-cat・h流通させ、触媒 b のホットスポットを360±1℃に保ちながら50時間、反応を行う。反応後、触媒 b についてE X A F S 法によって求めたピーク強度比率。ここで、触媒 a は、塩化水素を酸素によって酸化して塩素を生成する反応において、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生成活性が、2×10⁻⁴~3×10⁻⁴mol/min・gー触媒である担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。

[0011]

また、本発明のうち第三の発明は、担持酸化ルテニウム触媒が下記の工程を含

み、ヒドラジン処理工程を含まない調製方法により調製された触媒である、担持 酸化ルテニウム触媒の製造方法に係わるものである。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物をルチル結晶形を含有する酸化 チタン担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600 ℃以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還 元性ガス中で焼成する工程

[0012]

【発明の実施の形態】

本発明において製造される担持酸化ルテニウム触媒とは、以下の工程を含む調 製法で調製された担持酸化ルテニウム触媒である。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物を触媒担体に担持する工程 焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを200℃以上の温度で 、不活性ガス中、酸化性ガス中あるいは還元性ガス中で焼成する工程

ヒドラジン処理工程:焼成工程で得られたものをヒドラジンとアルカリの混合 溶液で処理する工程

酸化工程:ヒドラジン処理工程で得られたものを酸化する工程

[0013]

また、本発明において製造される担持酸化ルテニウム触媒は上記の主たる4工程を含む工程によって製造される触媒の他に、下記に述べる様に、上記のうち、担持工程、焼成工程の主たる2工程を含む工程によって製造される触媒も含まれ、次の2発明を完成させた。2発明は、それぞれの特徴を有するので、以下説明する。

[0014]

すなわち、上記に述べた2発明のうちの第一は、ルテニウム化合物を触媒担体に担持後、ルテニウム化合物を担体に担持したそのものを、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成して調製される、担持酸化ルテニウム触媒であって、製造された該触媒および該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒についてそれぞれ、下記の広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)

法で測定して得られたピーク強度比率の値をA(b)、B(b)とし、下記式(1)を充足する触媒である。

広域 X線吸収微細構造解析 (EXAFS) 法: 触媒 b を X線吸収微細構造解析 (XAFS) 法で測定する。その際に X線吸収スペクトルから求められる R u - K吸収端の広域 X線吸収微細構造 (EXAFS) スペクトルをフーリエ変換して得られた動径分布関数において 0.32 n m付近のピーク強度から求められる二酸化ルテニウム中のルテニウム原子の第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度を分子とし、粒子径 10 n m以上の二酸化ルテニウムの場合のピーク強度を分母とし、ピーク強度比率を求める。

[0015]

【数4】

 $1 \le B \ (b) / A \ (b) \le 1.45$ (1)

[0016]

ただしA(b)≦0.8

A (b):製造された該触媒 b について E X A F S 法によって求めたピーク強 度比率。

B(b):製造された該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒bについてEXAFS法によって求めたピーク強度比率。以下に50時間反応テストの方法を示す。すなわち、担持酸化ルテニウム触媒aおよびbを反応管の入口からを順に充填する。このとき、触媒aおよびbの充填比率は質量比で1:10とする。次ぎに、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水素ガスを0.185~0.197mol/g-cat·h流通させ、同時に、酸素ガスを0.092~0.098mol/g-cat·h流通させ、触媒bのホットスポットを360±1℃に保ちながら50時間、反応を行う。反応後、触媒bについてEXAFS法によって求めたピーク強度比率。ここで、触媒aは、塩化水素を酸素によって酸化して塩素を生成する反応において、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生成活性が、2×10⁻⁴~3×10⁻⁴mol/min·gー触媒である担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒bは本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒bは本発明によって製造される担持酸化ルテニウム

ム触媒である。

[0017]

また、上記に述べた2発明のうちの第二は、担持酸化ルテニウム触媒が下記の 工程を含み、ヒドラジン処理工程を含まない調製方法により調製された触媒であ る。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物をルチル結晶形を含有する酸化 チタン担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600 ℃以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還 元性ガス中で焼成する工程

[0018]

まず、ルテニウム化合物担持工程について説明する。担体としては、酸化チタン、アルミナ、酸化ジルコニウム、シリカ、チタン複合酸化物、ジルコニウム複合酸化物、アルミニウム複合酸化物、珪素複合酸化物などの元素の酸化物、及び複合酸化物があげられ、好ましい担体は、酸化チタン、アルミナ、酸化ジルコニウム、シリカで、更に好ましい担体は、酸化チタンである。

[0019]

特に好ましい担体としては、ルチル結晶系の酸化チタンを含有する酸化チタンであるが、酸化チタンとしてはルチル結晶系、アナターゼ結晶系、非晶質などが知られている。本発明において特に好ましく使用されるルチル結晶系の酸化チタンを含有する酸化チタンとは、X線回折分析法によって酸化チタン中のルチル結晶とアナターゼ結晶の比率を測定し、そのうちルチル結晶を含有するものを指す。測定方法については後で詳しく示す。本発明において使用する担体の化学組成が酸化チタン単独の場合はX線回折分析法による酸化チタン中のルチル結晶とアナターゼ結晶の比率からルチル結晶の割合が決定されるが、本発明においては酸化チタンと他の金属酸化物との複合酸化物も含まれるので、その場合は次に示す方法によってルチル結晶の割合が決定される。酸化チタンと複合化する酸化物としては元素の酸化物があげられるが、好ましくは、アルミナ、酸化ジルコニウム、シリカなどがあげられる。複合酸化物中のルチル結晶の割合は、同じくX線回

折分析法による酸化チタン中のルチル結晶とアナターゼ結晶の比率からルチル結晶の割合が決定されるが、ルチル結晶を含むことが必要である。また、この際、複合酸化物中の酸化チタン以外の酸化物の含量は0~60質量%の範囲である。 好ましい担体としては酸化チタン以外の金属酸化物を含まない酸化チタンがあげられる。

[0020]

酸化チタンはルチル結晶を含むことが必要であるが、好ましくは、ルチル結晶の比率は10%以上のものであり、更に好ましくは30%以上のものがあげられる。より更に好ましくは80%以上のものがあげられる。

[0021]

ルチル結晶を含む酸化チタンの調製法としては種々あげられるが、一般的に次 の調製例があげられる。たとえば、四塩化チタンを原料とする場合は、四塩化チ タンを氷冷した水に滴下溶解して、アンモニア水溶液で中和し、水酸化チタン(オルトチタン酸)を生成させる。その後、生成した沈殿を水洗して塩素イオンを 除去する。この際に、中和時の温度が20℃以上の高い温度になる場合や、洗浄 した後の酸化チタンに塩素イオンが残存している場合には、焼成時に安定なルチ ル結晶系への転移が起こりやすくなる。また、焼成温度も600℃以上になると ルチル化が生じる(「触媒調製化学」1989年、第211頁、講談社発行)。 また、たとえば、四塩化チタン蒸発器に酸素-窒素混合ガスを通じて反応ガスを 調製し、これを反応器に導入する。四塩化チタンと酸素との反応は400℃付近 から始まり、 $TiCl_4-O_2$ 系の反応で生成する二酸化チタンはアナターゼ型が 主であるが、反応温度が900℃以上になるとルチル型の生成が見られる(「触 媒調製化学」1989年、第89頁、講談社発行)。また、たとえば、四塩化チ タンを硫酸アンモニウムの存在下に加水分解した後、焼成する方法(たとえば、 「触媒工学講座10元素別触媒便覧」1978年、第254頁、地人書館発行) 、アナターゼ結晶系の酸化チタンを焼成する方法(たとえば、「金属酸化物と複 合酸化物」1980年、第107頁、講談社発行)などがあげられる。また、四 塩化チタンの水溶液を加熱加水分解する方法によって、ルチル結晶形の酸化チタ ンを得ることができる。更に、あらかじめ硫酸チタンや塩化チタンなどのチタン

化合物水溶液とルチル結晶系の酸化チタン粉末を混合しておき、加熱加水分解や アルカリ加水分解し、次いで、500℃前後の低温で焼成することによってもル チル結晶系の酸化チタンが生成する。

[0022]

酸化チタン中のルチル結晶の割合を決定する方法は、X線回折分析法であるが、X線源としてはいろいろな線源が使用される。たとえば、銅のKα線などがあげられる。銅のKα線を使用した場合、ルチル結晶の比率とアナターゼ結晶の比率はそれぞれ、(110)面の2θ=27.5度の回折ピークの強度と、(101)面の2θ=25.3度の回折ピークの強度を用いて決定する。本発明に使用する担体はルチル結晶のピーク強度及びアナターゼ結晶のピーク強度を有する物、又は、ルチル結晶のピーク強度を有する物である。すなわち、ルチル結晶の回折ピークの両方を有する物であってもよいし、ルチル結晶の回折ピークのみを有する物であってもよい。好ましくは、ルチル結晶のピーク強度とアナターゼ結晶のピーク強度の合計に対するルチル結晶のピーク強度の割合が10%以上のものがあげられる。

[0023]

担体に担持するルテニウム化合物としては、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、K $_3$ RuCl $_6$ 、 [RuCl $_6$] $^{3-}$ 、K $_2$ RuCl $_6$ などのクロロルテニウム酸塩、 [RuCl $_5$ (H $_2$ O) $_4$] $^{2-}$ 、 [RuCl $_2$ (H $_2$ O) $_4$] $^+$ などのクロロルテニウム酸塩水和物、K $_2$ RuO $_4$ などのルテニウム酸の塩、Ru $_2$ OCl $_4$ 、Ru $_2$ OCl $_5$ 、Ru $_2$ OCl $_6$ などのルテニウムオキシ塩化物の塩、 [Ru (NH $_3$) $_6$] $^{2+}$ 、 [Ru (NH $_3$) $_6$] $^{3+}$ 、 [Ru (NH $_3$) $_5$ H $_2$ O] $^{2+}$ などのルテニウムアンミン錯体、 [Ru (NH $_3$) $_5$ Cl] $^{2+}$ 、 [Ru (NH $_3$) $_6$] Cl $_2$ 、 [Ru (NH $_3$) $_6$] Cl $_3$ 、 [Ru (NH $_3$) $_6$] Br $_3$ などのルテニウムアンミン錯体の塩化物、 具化物、 RuBr $_3$ 、 RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム臭化物、 その他のルテニウム有機アミン錯体、 ルテニウムアセチルアセトナート錯体、 Ru (CO) $_5$ 、 Ru $_3$ (CO) $_{12}$ などのルテニウムカルボニル錯体、 [Ru $_3$ O (OCOCH $_3$) $_6$ (H $_2$ O) $_3$] OCOCH $_3$ 水和物、 Ru $_2$ (RCOO) $_4$ Cl (R

=炭素数 1-3 のアルキル基)などのルテニウム有機酸塩、 K_2 [RuCl $_5$ NO)]、 [Ru (NH $_3$) $_5$ (NO)] Cl $_3$ 、 [Ru (OH) (NH $_3$) $_4$ (NO)] (NO $_3$) $_2$ 、 Ru (NO) (NO $_3$) $_3$ などのルテニウムニトロシル錯体、ルテニウムホスフィン錯体などの化合物などがあげられる。好ましいルテニウム化合物としては、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム化合物があげられる。更に好ましくは、塩化ルテニウム水和物があげられる。

[0024]

担体にルテニウム化合物を担持する方法としては、含浸法、平衡吸着法などがあげられる。

[0025]

次に、焼成工程について説明する。ルテニウム化合物担持工程で得られたものを200℃以上の温度で、不活性ガス中、酸化性ガス中あるいは還元性ガス中で焼成する方法として、不活性ガスとしては窒素、ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気下で焼成する方法などがあげられる。酸化性ガスとしては空気、酸素及び、窒素と酸素の混合ガスなどがあげられる。還元性ガスとしては、水素、及び、水素と窒素の混合ガスなどがあげられる。

[0026]

この工程は、ルテニウム化合物を担体に担持した後、乾燥し、次いで、ルテニウム化合物を担体に固定化する工程であり、次のヒドラジン処理工程で、ルテニウム化合物を安定的に処理できるようにするための工程である。この工程を行った触媒を行わなかった触媒と比較すると、飛躍的に、次のヒドラジン処理工程が安定的に行われ、触媒活性が増加する。好ましくは、酸化性ガス中で焼成する方法があげられ、更に好ましくは、空気中で焼成する方法があげられる。

[0027]

次に、ヒドラジン処理工程について説明する。焼成工程で得られたものを、ヒドラジン処理する方法としてはヒドラジンとアルカリの混合溶液に浸漬したり、その混合溶液を含浸する方法があげられるが、使用されるアルカリとしては、アルカリ金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、及びアンモニア、炭酸アンモニウ

ム、炭酸水素アンモニウムなどの水溶液、アルコールなどの有機溶媒の溶液などがあげられる。アルカリとしては、好ましくはアルカリ金属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩が用いられる。溶媒としては水が好ましく用いられる。

[0028]

また、担体に担持したルテニウム化合物を焼成した後、液相で還元する方法も好ましい方法としてあげられるが、還元剤としてはメタノール、ホルムアルデヒド、メタノール、ホルムアルデヒドの水溶液やアルコールなどの有機溶媒の溶液、水素、NaBH $_4$ 、Na $_2$ B $_2$ H $_6$ 、Na $_2$ B $_4$ H $_10$ 、Na $_2$ B $_5$ H $_9$ 、LiBH $_4$ 、K $_2$ B $_2$ H $_6$ 、K $_3$ B $_4$ H $_10$ 、K $_2$ B $_5$ H $_9$ 、Al (BH $_4$) 3などの水素化ホウ素化合物、LiB [CH (CH $_3$) C $_2$ H $_5$] 3H、LiB (C $_2$ H $_5$) 3H、KB [CH (CH $_3$) CH (CH $_3$) 2] 3H、などの水素化ホウ素有機金属化合物、LiAlH、NaH、LiH、KHなどの金属水素化物、〔(CH $_3$) 2CHCH $_2$] 2AlHなどの有機アルミニウム化合物、有機リチウム化合物、有機ナトリウム化合物、有機カリウム化合物、有機マグネシウム化合物などがあげられる。

[0029]

ヒドラジン処理又は還元剤で処理した後にアルカリ金属塩化物を添加する方法 も好ましい方法である。

[0030]

次いで、酸化する方法としては、空気中で焼成する方法が例としてあげられる

[0031]

酸化ルテニウムと担体の質量比は、好ましくは、0. 1/99. 9~20. 0/80. 0であり、より好ましくは、0. 5/99. 5~15. 0/85. 0であり、更により好ましくは1. 0/99. 0~15. 0/85. 0である。酸化ルテニウムの比率が低すぎると活性が低くなる場合があり、酸化ルテニウムの比率が高すぎると触媒の価格が高くなる場合がある。担持する酸化ルテニウムとしては二酸化ルテニウム、水酸化ルテニウムなどが例としてあげられる。

[0032]

本発明に使用する担持酸化ルテニウム触媒を調製する好ましい具体例として、 以下の工程を含む調製方法をあげることができる。

ハロゲン化ルテニウム担持工程:ハロゲン化ルテニウムを触媒担体に担持する 工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを200℃以上の温度で、不活性ガス中、酸化性ガス中あるいは還元性ガス中で焼成する工程

ヒドラジン処理工程:焼成工程で得られたものをヒドラジンとアルカリの混合 溶液で処理する工程

酸化工程:ヒドラジン処理工程で得たものを酸化する工程

[0033]

また、本発明に使用する担持酸化ルテニウム触媒を調製する一層好ましい具体 例として、以下の工程を含む調製法をあげることができる。

ハロゲン化ルテニウム担持工程:ハロゲン化ルテニウムを触媒担体に担持する 工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを200℃以上の温度で、不活性ガス中、酸化性ガス中あるいは還元性ガス中で焼成する工程

ヒドラジン処理工程:焼成工程で得られたものをヒドラジンとアルカリの混合 溶液で処理する工程

アルカリ金属塩化物添加工程:ヒドラジン処理工程で得たものにアルカリ金属 塩化物を添加する工程

酸化工程:アルカリ金属塩化物添加工程で得たものを酸化する工程

[0034]

ハロゲン化ルテニウム担持工程は、ハロゲン化ルテニウムを触媒担体に担持する工程である。担体に担持するルテニウム化合物としては、既に例示した種々のルテニウム化合物があげられるが、その中でも、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム臭化物などルテニウムのハロゲン化物が好ましい例としてあげられる。好ましいハロゲン化ルテニウムとしては、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、

くは、塩化ルテニウム水和物があげられる。

[0035]

ハロゲン化ルテニウム担持工程で使用されるハロゲン化ルテニウムの量は、好ましい酸化ルテニウムと担体の質量比に対応する量が通常使用される。すなわち、既に例示した触媒担体に、ハロゲン化ルテニウムの溶液を含浸させる、平衡吸着させるなどの方法で担持する。溶媒としては水やアルコールなどの有機溶媒が使用されるが、好ましくは水があげられる。次に、含浸したものを乾燥することもできるし、乾燥しないこともできるが、乾燥する方法が好ましい例としてあげられる。この乾燥は含浸したハロゲン化ルテニウム水溶液の水分を除去する操作であり、次の、焼成工程とは意味の異なる操作として区別される。

[0036]

焼成工程はルテニウム化合物担持工程で得たものを200℃以上の温度で、不活性ガス中、酸化性ガス中あるいは還元性ガス中で焼成する工程である。不活性ガスとしては窒素、ヘリウムなどの不活性ガスなどがあげられる。酸化性ガスとしては空気、酸素及び、窒素と酸素の混合ガスなどがあげられる。還元性ガスとしては、水素、及び、水素と窒素の混合ガスなどがあげられる。好ましくは、酸化性ガス中で焼成する方法があげられる。更に好ましくは、空気中で焼成する方法があげられる。焼成する温度としては200℃以上であるが、温度が高すぎると担持したルテニウム化合物がシンタリングし、活性が低下する恐れがある。好ましい焼成温度の範囲としては200~300℃、更に好ましくは、200~250℃があげられる。

[0037]

ヒドラジン処理工程は焼成工程で得たものをヒドラジンとアルカリの混合溶液で処理する工程である。ヒドラジンとアルカリの混合溶液で処理する方法としては、ヒドラジンとアルカリの混合溶液に含浸する、ヒドラジンとアルカリの混合溶液に浸漬するなどの方法がある。ヒドラジン処理工程で使用されるヒドラジンの濃度は、好ましくは0.1mol/l以上があげられるが、ヒドラジン一水和物などのヒドラジン水和物をそのまま用いてもよい。あるいは水やアルコールなどの有機溶媒の溶液として使用される。好ましくは、ヒドラジン水溶液あるいは

ヒドラジン水和物が用いられる。ヒドラジンは無水物も一水和物も使用できる。ハロゲン化ルテニウムとヒドラジンのモル比は、好ましくはハロゲン化ルテニウムの0.1~20倍モルが使用される。ハロゲン化ルテニウムとアルカリのモル比はハロゲン化ルテニウム1モルに対してたとえば水酸化ナトリウムであれば3モルが当量であるが、好ましくはハロゲン化ルテニウムの0.1~20倍当量のアルカリが使用される。アルカリの濃度は用いるアルカリによって異なるが、好ましくは0.1~10mo1/1があげられる。ヒドラジンとアルカリの溶液に浸漬する時間は好ましくは5分~5時間があげられる。温度範囲は、好ましくは0~100℃があげられるが、より好ましくは、10~60℃があげられる。ヒドラジンとアルカリの溶液に浸漬した後に好ましくは、処理した固体は溶液と適別される。

[0038]

より好ましい方法としては、ヒドラジン処理工程で製造したものを洗浄してアルカリ及びヒドラジンを除去し、乾燥して、次のアルカリ金属塩化物添加工程でアルカリ金属塩化物を添加した後、乾燥し、酸化する方法があげられる。

[0039]

更に好ましい方法としては、ヒドラジン処理工程で製造した触媒を、アルカリ金属塩化物の水溶液で洗浄した後、乾燥し、酸化する方法があげられる。この方法は、アルカリ及びヒドラジンの除去とアルカリ金属塩化物の添加を同じ工程で行えるため好ましい。

[0040]

アルカリ金属塩化物添加工程はヒドラジン処理工程で得たものにアルカリ金属 塩化物を添加する工程である。この工程は、担持酸化ルテニウム触媒を調製する 上で必須の工程ではないが、該工程を行うことによって触媒の活性が一層向上す る。すなわち、次の酸化工程で触媒を酸化するが、その際に、アルカリ金属塩の 存在下、ヒドラジン処理した触媒を酸化することにより高活性な担持酸化ルテニ ウムに変換することが好ましい調製例である。

[0041]

アルカリ金属塩化物としては、塩化カリウム、塩化ナトリウムなどのアルカリ

金属の塩化物をあげることができ、好ましくは塩化カリウム、塩化ナトリウム、 更に好ましくは塩化カリウムである。ここで、アルカリ金属塩/ルテニウムのモル比は、0.01~10が好ましく、0.1~5.0が更に好ましい。アルカリ金属塩の使用量が過少であると十分な高活性触媒が得られず、一方アルカリ金属塩の使用量が過多であると工業的にコスト高を招く。

[0042]

アルカリ金属塩化物の添加方法としては、洗浄、乾燥されたヒドラジン処理ルテニウム触媒にアルカリ金属塩化物の水溶液を含浸する方法があげられるが、ヒドラジン処理されたルテニウム触媒を水で洗浄しないで、アルカリ金属塩化物水溶液で洗浄して含浸する方法が更に好ましい方法としてあげられる。

[0043]

触媒の洗浄の際にpHを調整する目的でアルカリ金属塩化物の水溶液に塩酸を添加することもできる。アルカリ金属塩化物の水溶液の濃度は好ましくは0.01~10mo1/1があげられるが、より好ましくは、0.1~5mo1/1があげられる。

[0044]

洗浄の目的はアルカリ及びヒドラジンを除去することであるが、本発明の効果 を損ねない範囲でアルカリ及びヒドラジンを残存させることもできる。

[0045]

アルカリ金属塩化物を含浸した後、触媒は通常乾燥される。乾燥条件は、好ま しくは50~200℃の範囲であり、好ましくは1~10時間である。

[0046]

酸化工程はヒドラジン処理工程で得られたものを酸化する工程(アルカリ金属 塩化物添加工程を用いない場合)であるか、又はアルカリ金属塩化物添加工程で 得たものを酸化する工程(アルカリ金属塩化物添加工程を用いた場合)である。 酸化工程としては空気中で焼成する方法をあげることができる。酸素を含有する 気体中で、アルカリ金属塩の存在下、ヒドラジン処理したものを焼成することに より高活性な担持酸化ルテニウムに酸化することが好ましい調製例である。酸素 を含有する気体としては、通常は空気があげられる。

[0047]

焼成温度の範囲は、好ましくは $100\sim600$ ℃であり、より好ましくは $280\sim450$ ℃である。焼成温度が低すぎるとヒドラジン処理により生成した粒子が酸化ルテニウム前駆体のまま多く残存し、触媒活性が不十分となる場合がある。また、焼成温度が高すぎると酸化ルテニウム粒子の凝集が起こり、触媒活性が低下する。焼成時間は、好ましくは $30分\sim10$ 時間である。

[0048]

この場合、アルカリ金属塩の存在下に焼成することが重要である。この方法により、より細かい粒子の酸化ルテニウムを生成し、アルカリ金属塩の実質的な非存在下に焼成するのに比べて、より高い触媒活性を得ることができる。

[0049]

焼成により、担体に担持されたヒドラジン処理により生成した粒子は担持酸化ルテニウム触媒に変換される。ヒドラジン処理により生成した粒子が酸化ルテニウムに変換されたことはX線回折やXPS (X線光電子分光)などの分析により確認することができる。なお、ヒドラジン処理により生成した粒子は、その実質上の全量が酸化ルテニウムに変換されていることが好ましいが、本発明の効果を損ねない範囲で、ヒドラジン処理により生成した粒子が残留していることも許容され得る。

[0050]

ヒドラジン処理をしたものを酸化処理をした後に、残存しているアルカリ金属 塩化物を水洗、乾燥する方法が好ましい調製方法である。焼成時に含有されてい るアルカリ金属塩化物は水で十分洗浄されることが好ましい。洗浄後のアルカリ 金属塩化物の残存量を測定する方法としては濾液に硝酸銀水溶液を加えて白濁の 有無を調べる方法がある。しかし本触媒の触媒活性を損ねない範囲でアルカリ金 属塩化物が残存していてもかまわない。

[0051]

洗浄した触媒は次に乾燥することが好ましい調製方法である。乾燥する条件は 好ましくは50~200℃の範囲であり、好ましくは1~10時間である。

[0052]

次に、本発明のうち第二の発明について説明する。本発明において製造される 担持酸化ルテニウム触媒とは、ルテニウム化合物を触媒担体に担持して、次に、 ルテニウム化合物を担体に担持したものを、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還 元性ガス中で焼成して調製される、担持酸化ルテニウム触媒であって、製造され た該触媒および該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒につ いてそれぞれ、下記の広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)法で測定して得 られたピーク強度比率の値をA(b)、B(b)とし、下記式(1)を充足する 触媒である。

広域 X 線吸収微細構造解析 (E X A F S) 法: 触媒 b を X 線吸収微細構造解析 (X A F S) 法で測定する。その際に X 線吸収スペクトルから求められる R u ー K 吸収端の広域 X 線吸収微細構造 (E X A F S) スペクトルをフーリエ変換して得られた動径分布関数において 0.32 n m付近のピーク強度から求められる二酸化ルテニウム中のルテニウム原子の第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度を分子とし、粒子径 10 n m以上の二酸化ルテニウムの場合のピーク強度を分母とし、ピーク強度比率を求める。

[0053]

【数 5】

 $1 \le B \ (b) / A \ (b) \le 1.45$ (1)

[0054]

ただしA(b)≦0.8

A (b):製造された該触媒 b について E X A F S 法によって求めたピーク強度比率。

B(b):製造された該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した 触媒 b についてE X A F S 法によって求めたピーク強度比率。以下に50時間反応テストの方法を示す。すなわち、担持酸化ルテニウム触媒 a および b を反応管の入口からを順に充填する。このとき、触媒 a および b の充填比率は質量比で1:10とする。次ぎに、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水素ガスを0.185~0.197mol/g-cat·h流通させ、同時に、酸素ガスを0.092~0.098mol/g-cat·h流通させ、触媒 b のホ ットスポットを 360 ± 1 ℃に保ちながら50時間、反応を行う。反応後、触媒 bについてEXAFS法によって求めたピーク強度比率。ここで、触媒 a は、塩化水素を酸素によって酸化して塩素を生成する反応において、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生成活性が、 $2\times10^{-4}\sim3\times10^{-4}$ mo1/min·g-触媒である担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。

ここで、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験とは具体的には、以下の方法が挙げられる。すなわち、得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒2.5gを2mm球の市販のα-アルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)10gとよく混合することにより触媒を希釈して石英製反応管(内径12mm)に充填し、塩化水素ガスを192ml/min、酸素ガスを192ml/min(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、内温(ホットスポット)を300℃とした。反応開始2.0時間後の時点で、反応管出口のガスを30質量%ヨウ化カリウム水溶液に流通させることによりサンプリングを行い、ヨウ素滴定法及び中和滴定法によりそれぞれ塩素の生成量及び未反応塩化水素量を測定した。単位触媒質量当りの塩素の生成活性は、下式により求めた。

単位触媒質量当りの塩素生成活性 (mol/min・gー触媒) =単位時間当 りの出口塩素生成量 (mol/min) /触媒質量 (g)

[0055]

すなわち、担持酸化ルテニウム触媒としては次が挙げられる。EXAFS測定法で担体上の二酸化ルテニウム中のルテニウムの第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度を分子とし、粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムの場合のピーク強度を分母とし、ピーク強度比率を求めると、そのピーク強度比率が、担体に担持した二酸化ルテニウムの構造を表していることを見出して、触媒活性と相関があることが分かった。

[0056]

すなわち、動径分布関数における0.32nm付近のピーク強度から求められ

る二酸化ルテニウム中のルテニウムの第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度比率を使用し、かつ、担体上の二酸化ルテニウム形状を仮定した場合、二酸化ルテニウムブロックの大きさが求められる。このとき、仮定する二酸化ルテニウムの形状によって好ましい二酸化ルテニウムブロックの大きさは変化するが、粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムの場合のピーク強度を分母とし、二酸化ルテニウム中のルテニウムの第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度を分子とした、ピーク強度比率は0.8以下であることが本願発明の二酸化ルテニウムブロックの大きさに対応する。

[0057]

さらに、二酸化ルテニウム中のルテニウムの第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度比率を触媒の反応前後で比較すると、二酸化ルテニウムブロックの大きさの変化が求められ、担体上の二酸化ルテニウムのシンタリングの進行が測定できる。本願発明は、二酸化ルテニウム中のルテニウムの第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度比率を触媒の反応前後で測定し、比率が1.45以下である触媒を製造する方法であり、具体的な調製方法の例については、後に記述する。

[0058]

本触媒に特徴的なことは、担持酸化ルテニウム触媒を用いて、目的物質を製造する場合に、上記で規定した特定の酸化ルテニウム触媒を用いると酸化ルテニウムのシンタリングが少ないという点にある。以上のことにより、EXAFSから求めた動径分布関数における0. 32nm付近のピーク強度から求められる二酸化ルテニウムのルテニウムの第二近接のルテニウム原子数に対応するスペクトルのピーク強度比率が、触媒活性と相関があることを見いだし、本発明を完成させた。ここで、B(b)/A(b) はより好ましくは $B(b)/A(b) \leq 1$. 40 が上げられ、さらに好ましくは $B(b)/A(b) \leq 1$. 25 が上げられる。また、A(b) はより好ましくは $A(b) \leq 0$. 7 が上げられる。

[0059]

ここで、一般的なX線吸収微細構造解析(XAFS)の測定について説明するが、その原理および解析法は、例えば、「日本分光学会測定法シリーズ26 X

線吸収微細構造 宇田川康夫編(1993年)」などの書籍に詳しい。

X線のビームライン上に物質をおいた場合、物質に照射されたX線(入射X線:I 0)強度と物質を透過してきたX線(透過X線:I t)強度とから、その物質のX線吸光度が算出される。X線吸光度の増減をモニターしながらX線エネルギーを変化させ、X線吸収スペクトルを測定すると、あるエネルギー位置でX線吸光度の急激な立ち上がり(吸収端)が観測される。X線吸収スペクトルにおいて、この吸収端から30~1000eV程度高エネルギー側の領域に現れる微細な振動構造が広域X線吸収微細構造(EXAFS)といわれる。こうした吸収原子のX線吸収確率の変動は、X線の吸収により吸収原子から放出される光電子波と、それが周囲の原子により散乱されて戻ってくる光電子波の干渉効果の結果、引き起こされる。従って、これを詳細に解析することにより吸収原子近傍の局所構造に関する情報が得られる。

[0060]

X線吸収スペクトルから抽出されたEXAFSスペクトルに適当な領域でフーリエ変換を施すと、X線吸収原子を中心とした動径分布関数が求まる。この動径分布関数を詳細に吟味することによって、この関数の極大値の位置からは吸収原子と散乱原子との距離に、その強度からは散乱原子の数に関する情報を得ることができ、注目する吸収原子近傍の構造情報を明らかにできる。

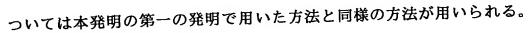
[0061]

以下に、具体的な触媒の製造方法の例を記述する。本願発明は、ルテニウム化合物を触媒担体に担持後、ルテニウム化合物を担体に担持したそのものを、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成して、担持酸化ルテニウム触媒を製造する方法である。

[0062]

まず、ルテニウム化合物担持工程について説明する。担体としては、本発明の 第一の発明で用いた担体と同様の担体が用いられる。

本発明において特に好ましく使用されるルチル結晶系の酸化チタンを含有する酸化チタンとは、X線回折分析法によって酸化チタン中のルチル結晶とアナターゼ結晶の比率を測定し、そのうちルチル結晶を含有するものを指す。測定方法に



[0063]

酸化チタンはルチル結晶を含むことが必要であるが、好ましくは、ルチル結晶の比率は10%以上のものであり、更に好ましくは30%以上のものがあげられる。より更に好ましくは80%以上のものがあげられる。

[0064]

担体に担持するルテニウム化合物としては、本発明の第一の発明で用いたルテニウム化合物があげられる。好ましいルテニウム化合物としては、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム臭化物などハロゲン化ルテニウム化合物があげられる。更に好ましくは、塩化ルテニウム水和物があげられる。

[0065]

担体にルテニウム化合物を担持する方法としては、含浸法、平衡吸着法などがあげられる。

[0066]

次いで焼成する方法としては、空気中で焼成する方法が例としてあげられる。

[0067]

酸化ルテニウムと担体の質量比は、好ましくは、0. 1/99. 9~20. 0/80. 0であり、より好ましくは、0. 5/99. 5~15. 0/85. 0であり、更により好ましくは1. 0/99. 0~15. 0/85. 0である。酸化ルテニウムの比率が低すぎると活性が低くなる場合があり、酸化ルテニウムの比率が高すぎると触媒の価格が高くなる場合がある。担持する酸化ルテニウムとしては二酸化ルテニウム、水酸化ルテニウムなどが例としてあげられる。

[0068]

本発明の第二の発明である担持酸化ルテニウム触媒を調製する一層好ましい具体例として、以下の工程を含む調製方法をあげることができる。

ハロゲン化ルテニウム担持工程: ハロゲン化ルテニウムを触媒担体に担持する 工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上の温度

で、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成する工程 【0069】

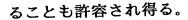
ハロゲン化ルテニウム担持工程は、ハロゲン化ルテニウムを触媒担体に担持する工程である。担体に担持するルテニウム化合物としては、既に例示した種々のルテニウム化合物があげられるが、その中でも、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム臭化物などルテニウムのハロゲン化物が好ましい例としてあげられる。好ましいハロゲン化ルテニウムとしては、RuCl $_3$ 、RuCl $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、RuBr $_3$ 、RuBr $_3$ 水和物などのルテニウム塩化物、

[0070]

焼成工程はルテニウム化合物担持工程で得られたものを200℃以上の温度で、酸化性ガス中、不活性ガス中あるいは還元性ガス中で焼成する工程である。焼成方法として、不活性ガスとしては窒素、ヘリウムなどの不活性ガス雰囲気下で焼成する方法などがあげられる。酸化性ガスとしては空気、酸素及び、窒素と酸素の混合ガスなどがあげられる。還元性ガスとしては、水素、及び、水素と窒素の混合ガスなどがあげられる。好ましくは空気中で焼成する方法をあげることができる。酸素を含有する気体中で、ハロゲン化ルテニウム担持したものを焼成することにより高活性な担持酸化ルテニウムに酸化することが好ましい調製例である。酸素を含有する気体としては、通常は空気があげられる。

[0071]

焼成温度の範囲は、好ましくは250~600℃であり、より好ましくは250~450℃である。さらに好ましくは250~400℃があげられ、特に好ましくは250~350℃があげられる。焼成温度が低すぎるとルテニウム化合物が酸化されないまま多く残存し、触媒活性が不十分となる場合がある。また、焼成温度が高すぎると酸化ルテニウム粒子の凝集が起こり、触媒活性が低下する。焼成時間は、好ましくは30分~10時間である。なお、酸化工程により生成した粒子は、その実質上の全量が酸化ルテニウムに変換されていることが好ましいが、本発明の効果を損ねない範囲で、担持されたルテニウム化合物が残留してい



[0072]

ここで、B(b)を測定するための触媒 b を用いる、塩化水素を酸化して塩素を得る反応方法について以下に説明する。すなわち、反応管に用いられる材質としては、ニッケル、ガラス、石英ガラスなどがあげられる。反応ガスおよび生成ガスは腐食性を持つのでその他の材質を用いる場合は、注意が必要である。また、触媒 a および b を充填する際、触媒の活性が高い場合には反応熱が除熱しきれない事があるので、αアルミナボールなどで希釈し、除熱効率を上げることもできる。触媒層の熱伝導度が不十分な場合、反応熱が除熱できず、温度が局所的に上昇して、反応温度の制御が困難となり、正しいテストができないことがある。触媒層 b にホットスポットを設定し、ホットスポットの温度は360±1℃とする。通常、触媒 a および b については温度分布がつくため触媒層の温度範囲は320~360℃で反応する。反応温度が高すぎると触媒活性点であるRuO2の凝集が早く進行し正しいB(b)が測定できない。一方、反応温度が低すぎても触媒活性点であるRuO2の凝集が遅く進行し正しいB(b)が測定できない。このような点に注意し、反応を行えば再現性の良いテスト結果を得ることができる。

すなわち、本願発明の担持酸化ルテニウム触媒としては次が示される。 EXA FS測定法で担体上の二酸化ルテニウム中のルテニウムの第二近接のルテニウム 原子数に対応するスペクトルのピーク強度比率が反応前後で $1 \leq B$ (b) / A (b) ≤ 1 . 45である担持酸化ルテニウム触媒であることが分かった。広域X線吸収微細構造 (EXAFS) 法で測定したスペクトルのピーク強度比率が、担体に担持した二酸化ルテニウムの構造を表していることを見出し、その安定性が触媒の活性安定性と相関があることが分かった。

すなわち、反応前後のピーク強度の比率が小さいほど二酸化ルテニウムのシンタリングが小さい触媒であることが分かった。

[0073]

従来の触媒の調製法では、担持工程、焼成工程、ヒドラジン処理工程、酸化工程の4工程やこれらに更にアルカリ金属塩化物担持工程や水洗工程を加える場合

もあり、付随する乾燥工程なども考慮すると、かなり複雑な触媒調製工程であったが、以上のような触媒調製法を用いると工程数も主として担持工程、焼成工程の2工程で行うことができ、触媒調製時間の短縮、触媒コストの削減が可能となった。また、触媒の活性については塩化ルテニウムを水素で還元した触媒を酸化して調製した触媒よりも高活性であり、アナターゼ型酸化チタンを担体として用いた場合に比べても高活性であった。

[0074]

次に、本発明のうち第三の発明について説明する。本発明において製造される 担持酸化ルテニウム触媒とは、下記の工程を含み、ヒドラジン処理工程を含まな い調製方法により調製された触媒である。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物をルチル結晶形を含有する酸化 チタン担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600 ℃以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還 元性ガス中で焼成する工程

[0075]

さらに、好ましくは、担持酸化ルテニウム触媒が下記の工程を含み、ヒドラジン処理工程を含まない調製方法により調製された触媒であって、製造された該触媒および該触媒を下記に示す50時間反応テスト後に取り出した触媒についてそれぞれ、下記の触媒活性試験方法で測定して得られた値をC(b)、D(b)とし、下記式(2)を充足する触媒である。

ルテニウム化合物担持工程:ルテニウム化合物をルチル結晶形を含有する酸化 チタン担体に担持する工程

焼成工程:ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600℃ 以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元 性ガス中で焼成する工程

[0076]

触媒活性試験方法:触媒2.3~2.5gを2mm球の市販のα-アルミナ担体10~20gとよく混合することにより触媒を希釈して石英製反応管(内径1

2 mm) に充填し、塩化水素ガスを190~210ml/min、酸素ガスを190~210ml/min (いずれも0℃、1気圧換算) 常圧下に供給する。石英反応管を電気炉で加熱し、内温 (ホットスポット) を300±1℃とする。反応開始2.0±1.0時間後の時点で、反応管出口のガスを30質量%ヨウ化カリウム水溶液に流通させることによりサンプリングを行い、ヨウ素滴定法及び中和滴定法によりそれぞれ塩素の生成量及び未反応塩化水素量を測定する。次の式で求められた単位触媒質量当りの塩素生成活性を触媒活性とする。

[0077]

単位触媒質量当りの塩素生成活性 (mol/min・gー触媒) =単位時間当りの出口塩素生成量 (mol/min)/触媒質量(g)

[0078]

【数6】

0. $79 \le D$ (b) /C (b) ≤ 1 (2)

[0079]

ただし3. 0×10⁻⁴mol/min·g-触媒≦C (b)

C (b): 触媒 b について触媒活性試験方法によって求めた触媒活性。

D(b):以下に50時間反応テストの方法を示す。すなわち、担持酸化ルテニウム触媒 a および b を反応管の入口からを順に充填する。このとき、触媒 a および b の充填比率は質量比で1:10とする。次に、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水素ガスを0.185~0.197mo1/g-c a t・h流通させ、同時に、酸素ガスを0.092~0.098mo1/g-c a t・h流通させ、触媒 b のホットスポットを360±1℃に保ちながら50時間、反応を行う。D(b)は、反応後、触媒 b について触媒活性試験方法によって求めた触媒活性。ここで、触媒 a は、塩化水素を酸素によって酸化して塩素を生成する反応において、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生成活性が、2×10⁻⁴~3×10⁻⁴mo1/min・g-触媒である担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。

[0800]

以下に具体的な触媒調製方法を説明する。すなわち、ルテニウム化合物担持工程では、本発明のうち第一の発明、第二の発明で説明した、ルテニウム化合物担持方法が用いられるが、担体として、本発明のうち第一の発明で説明した、ルチル結晶形を含有する酸化チタン担体が用いられる。

焼成工程では、本発明のうち第二の発明で説明した焼成方法が用いられる。すなわち、ルテニウム化合物担持工程で得られたものを、200℃以上600℃以下の温度範囲を用いることを特徴とし、酸化性ガス中、不活性ガス中又は還元性ガス中で焼成する方法で行われるが、好ましい焼成温度も、本発明のうち第二の発明で説明した温度が用いられる。

上記の、ルチル結晶形を含有する酸化チタン担体にルテニウム化合物を担持した後に焼成を行い、ヒドラジン処理工程を含まないで調製した触媒は、360±1℃で反応を行った場合、反応前の触媒の活性試験結果に比べて、反応後の触媒の活性試験結果が、活性低下が少ないという特徴を有している。

[0081]

すなわち、触媒 b について触媒活性試験方法によって求めた触媒活性をC(b)とする。次ぎに、触媒 a および b を反応管の入口からを順に充填する。このとき、触媒 a および b の充填比率は質量比で1:10とする。次ぎに、常圧下において、触媒の単位質量当り、1時間に塩化水素ガスを0.185~0.197mol/g-cat・h流通させ、同時に、酸素ガスを0.092~0.098mol/g-cat・h流通させ、触媒 b のホットスポットを360±1℃に保ちながら50時間、反応を行う。ここで、触媒 a は、塩化水素を酸素によって酸化して塩素を生成する反応において、塩化水素と酸素のモル比を1として、300℃で行う試験における単位触媒質量当たりの塩素の生成活性が、2×10⁻⁴~3×10⁻⁴mol/min・gー触媒である担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。また触媒 b は本発明によって製造される担持酸化ルテニウム触媒である。そして、反応後、触媒 b について触媒活性試験方法によって求めた触媒活性をD(b)とすると、D(b)/C(b)は0.79以上であるという特徴を有している。よって、ルチル結晶形を含有する酸化チタン担体にルテニウム化合物を担持した後に焼成を行い、ヒドラジン処理工程を含まないで調製した触媒は、好ましくは、D

(b) /C (b) が 0.79以上であるという特徴を有し、さらに好ましくは、 D(b) /C (b) が 0.81以上である触媒が用いられ、さらにより好ましく は、 D(b) /C (b) が 0.84以上である触媒が用いられる。

C (b) については3. 0以上であるが、好ましくは3. 5以上が挙げられる。以上の工程で製造された担持酸化ルテニウム触媒は高活性であった。

[0082]

本発明の触媒を用いて、塩化水素を酸素により酸化することにより塩素を得ることもできる。塩素を得るにあたり、反応方式としては固定床又は流動層等の流通方式があげられ、通常固定床気相流通方式、気相流動層流通方式などの気相反応が好ましく採用される。固定床式は反応ガスと触媒の分離が不要であり、原料ガスと触媒の接触を十分行うことができるので高転化率を達成できるなどの利点がある。また、流動層方式は反応器内の除熱を十分に行うことができ、反応器内の温度分布幅を小さくできる利点がある。

[0083]

反応温度は、高温の場合、高酸化状態のルテニウム酸化物の揮散が生じるのでより低い温度で反応することが望まれ、100~500℃が好ましく、より好ましくは200~380℃の範囲があげられる。反応圧は通常大気圧~50気圧程度である。酸素原料としては、空気をそのまま使用してもよいし、純酸素を使用してもよいが、好ましくは不活性な窒素ガスを装置外に放出する際に他の成分も同時に放出されるので不活性ガスを含まない純酸素があげられる。塩化水素に対する酸素の理論モル量は1/4モルであるが、理論量の0.1~10倍供給するのが通常である。また、触媒の使用量は、固定床気相流通方式の場合で、大気圧下原料塩化水素の供給速度との比GHSVで表わすと、通常10~20000h-1程度である。

[0084]

【実施例】

以下に実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれら実施 例より限定されるものではない。

[0085]

実施例1

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、S TR-60尺、100%ルチル結晶系) 50.0gに純水35.3gと酸化チタ ンゾル (堺化学(株)CSB, TiO₂含量38質量%) 6.6gを加え混練した 。この混合物を1.5mmφのヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、 60℃で2時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタン49.1gを得た。この操 作と同様の操作を行い、合計105.0gの白色のヌードル状酸化チタンを得た 。得られた固体を空気中で、室温から700℃まで2時間で昇温し、同温度で3 時間焼成し、102.3g白色のヌードル状酸化チタンを得た。焼成後、ヌード ル状固体を5mm程度の長さに切り揃えることにより、白色押出し状酸化チタン - 担体を得た。次いで、この担体100.0gに市販の塩化ルテニウム(RuC1 3・n H₂O、R u 含量 3 7. 3 質量%) 1 2. 7 5 g と 4 2. 5 g の純水に溶解 して調製した水溶液を含浸し、60℃で2時間乾燥した。次いで、得られた固体 21.6gを分取し、室温から200℃まで空気雰囲気下、1時間で昇温し、同 温度で2時間焼成した。焼成したものを2N水酸化カリウム溶液13.3gと純 水120g、ヒドラジン1水和物3.20gからなる溶液中に浸した。浸すと同 時に発泡が起きた。155分後、上澄液を濾別により除去した。ついで、得られ た固体に500m1の純水を加えて、30分間洗浄した後、濾別した。この操作 を8回くりかえした。この時の1回目の洗浄液のpHは11.4、8回目の洗浄 液のpHは7.4であった。濾別した固体に0.5mo1/1塩化カリウム溶液 50gを加えて撹拌した後に再び固体を濾別した。この操作を3回繰り返した。 得られた固体を60℃で4時間乾燥し、黒色固体を得た。次いで、空気中で、室 温から350℃まで1時間で昇温し、同温度で3時間焼成し20.9gの黒色固 体を得た。焼成後、500m1の純水を加えて攪拌した後、固体を濾別した。こ の操作を6回繰り返し、洗液に硝酸銀水溶液を滴下し、塩化カリウムの残存して いないことを確認した。次いで、この固体を60℃で4時間乾燥することにより 、20.6gの黒色押出し状酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒を得た。

[0086]

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2+TiO_2) \times 100=5$. 9質量%であった。 ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2) \times 100=4.5 質量%であった。$

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒2.5gを2mm球の市販のα-アルミナ担体 (ニッカトー(株)製、SSA995)10gとよく混合することにより触媒を希釈して石英製反応管 (内径12mm)に充填し、塩化水素ガスを192m1/min、酸素ガスを192m1/min (いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、内温(ホットスポット)を300℃とした。反応開始2.0時間後の時点で、反応管出口のガスを30質量%ヨウ化カリウム水溶液に流通させることによりサンプリングを行い、ヨウ素滴定法及び中和滴定法によりそれぞれ塩素の生成量及び未反応塩化水素量を測定した。

下式により求めた単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 11.0×10^{-4} mo $1/min\cdot g$ -触媒であった。

単位触媒質量当りの塩素生成活性 (mol/min·g-触媒) =単位時間当りの出口塩素生成量 (mol/min)/触媒質量 (g)

[0087]

実施例2

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、STR-60R、100%ルチル結晶系)60.0gに純水44.8gと38%酸化チタンゾル(堺化学(株)、CSB)7.9gからなる混合溶液を添加し、混合した。次に室温下に乾燥しながらよく混練した。この混合物を1.5mmφのヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、60℃で4時間乾燥し、58.0gの白色のヌードル状酸化チタンを得た。得られた固体を空気中で、室温から700℃まで1.9時間で昇温し、同温度で3時間焼成し、白色のヌードル状酸化チタン56.5gを得た。焼成後、ヌードル状固体を5mm程度の長さに切り揃えることにより、白色押出し状酸化チタン担体を得た。次いで、この担体20.0gに市販の塩化ルテニウム(RuС13・nH2〇、Ru含量38.2質量%)2.39gを10.4gの純水に溶解して調製した水溶液を含浸し、室温で一晩

静置した。次に、60℃で2時間乾燥した。次いで、得られた固体を、室温から350℃まで空気流通下(200ml/min)、1.8時間で昇温し、同温度で2時間焼成することにより20.9gの黒色押出し状酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 /(RuO₂+TiO₂)×100=5.6質量%であった。

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2) \times 100=4$. 3質量%であった。

このようにして得られた触媒を触媒bとした。

[0088]

EXAFSの測定方法

触媒 b のR u - K吸収端EXAFSの測定は、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究所放射光実験施設ビームライン10B(BL-10B)のXAFS測定装置で実施した。Si(311)チャンネルカット分光結晶を用い、入射X線強度(I0)は検出ガスにArを使用した17cmのイオンチェンバー、透過光強度(It)は、Krを使用した31cmのイオンチェンバーを用いて、常温下で測定した。また、この際の測定領域、即定点の間隔、及び測定点1点当りの積算時間の設定は以下の通りである。

[0089]

入射 X 線のエネルギー(E)が21590e V から22040e V までの区間を 、6.43e V 間隔で各点1秒積算(測定点数は70点)

入射 X 線のエネルギー(E)が22040e V から22190e V までの区間を、

1 e V間隔で各点1秒積算(測定点数は150点)

入射 X 線のエネルギー(E)が22190e V から22590e V までの区間を、

2. 5 e V間隔で各点2秒積算 (測定点数は160点)

入射 X 線のエネルギー(E)が22590e Vから23190e Vまでの区間を、

6 e V間隔で各点2秒積算(測定点数は101点)。なお、エネルギーの校正は

、金属銅のK吸収端のX線吸収端近傍構造(XANES; X-ray Abs

orption Near-Edge Structure) スペクトルにおい

て現れるプレエッジピークのエネルギー値(8980.3eV)の位置において 、分光結晶の角度を24.934度として行った。

[0090]

EXAFSの解析方法

触媒 b の吸収端のエネルギーΕ O は、二酸化ルテニウムのK吸収端エネルギーΕ O と同じ 2 2 1 2 3 e V とした。なお、Ε O は、X線吸収端付近のスペクトルにおいて、その一階微分係数が最大となるエネルギー値の事である。吸収端よりも低いエネルギー域の吸収係数にVictoreenの式(A λ 3 –

吸収端よりも低いエネルキー吸の吸収係致に V1 C L O F e e I1 の式(A χ 1 B χ 4+C; χ 4 は入射 χ 4 線の波長、A, B, C は任意の定数)を最小自乗法で当てはめて決定したバックグランドを差し引き、引き続いて重み付き χ 5 C u b i c S p 1 i n e 法により孤立原子の吸光度を見積もり、E χ 5 A F S 関数 χ 6 (k) を抽出した。なお、k は 5.123 × (E - E 0) χ 6 で定義される光電子の波数の事で、このときのk の単位は n m χ 7 である。

最後に、 k^3 で重み付けしたEXAFS関数 k^3 χ (k) を、k が 27 n m $^{-1}$ から 159 n m $^{-1}$ の範囲でフーリエ変換して動径分布関数を求めた。なお、フーリエ変換の窓関数には Hanning 関数を、窓幅には 0.5 n m $^{-1}$ を用いた。

[0091]

粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムとしては、NEケムキャット製(RuO₂:平均粒径25.9nm)を用い、上記触媒 b と同様にしてEXAFSの動径分布関数を求めた。

動径分布関数の0.32nm付近のピークに対し、触媒bの強度を分子とし、 粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムのピーク強度を分母として、ピーク強度 比率A(b)を求めたところ、値0.69を得た。

[0092]

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒2.5gを実施例1と同様に反応管に充填し、実施例1に準拠して反応を行った。反応開始1.8時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は6.55×10⁻⁴mo1/min・gー触媒であった。

次の方法により触媒を調製した。すなわち、市販のαーアルミナ粉末(住友化

学工業(株)AES-12)30.1 gと塩化ルテニウム(RuCl3・ nH_2O 、Ru含量37.3質量%)1.62 gと3.0 gの純水およびアルミナゾル(日産化学社製、アルミナゾル200)8.53 gをよく混合した。混合したものに室温で乾燥空気を吹きかけ、担体が適当な粘度になるまで乾燥した。この混合物を1.5 $mm\phi$ のヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、60Cで4時間乾燥し、茶色のヌードル状塩化ルテニウムー α -アルミナを得た。得られた固体を空気中で、室温から350Cまで1時間で昇温し、同温度で3時間焼成し、25.8 gの灰色のヌードル状の α -アルミナ担持酸化ルテニウム触媒を得た

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2 + Al_2O_3) × 100 = 2.5 質量%であった。 ルテニウム含量の計算値は、$

 $Ru/(RuO_2+Al_2O_3) \times 100=1$. 9質量%であった。

このようにして得られた触媒と同様の調製法で調製した触媒を触媒aとした。

すなわち、触媒 a 2. 5 g を実施例 1 と同様に反応管に充填し、実施例 1 に準拠して反応を行った。反応開始 2. 0時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 2. 18×10^{-4} m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

[0093]

次に、B(b)を測定するためにテスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の入口から触媒 a 0. 25gを希釈剤せずに充填し、触媒 b 2. 50gを2mm球の市販のαーアルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)20gとよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192m1/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96m1/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒 b のホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒 b を抜出した。抜き出した触媒 b について塩素の生成活性を測定した。

すなわち、抜き出した触媒 b 2. 5 g を実施例 1 と同様に反応管に充填し、実

施例1に準拠して反応を行った。反応開始3.0時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は5.75×10⁻⁴mo1/min·g-触媒であった。

反応前の触媒 b について E X A F S 法から A (b) を求めたのと同様の方法で、反応後の触媒 b のピーク強度比率 B (b) を求めたところ、値 0 . 8 0 を得た。これらから、B (b) / A (b) = 1 . 1 6 2 2 3 4 5

また、触媒の初期活性と50時間反応後の活性の比はD(b)/C(b)=0 88となった。

[0094]

実施例3

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末 (堺化学(株)、S TR-60R、100%ルチル結晶系)800gと有機バインダー16gをよく 混合した。混合したものに純水360gと38%酸化チタンゾル(堺化学(株)、 CSB) 133gからなる混合溶液を添加し、混合した。次によく混練した。こ の混合物を $1.5mm\phi$ のヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、1.10℃で14時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタンを得た。ヌードル状固体を 5~3mm程度の長さに切り揃えることにより、白色の酸化チタンを得た。得ら れた固体のうち450gを分取し、空気中で、室温から700℃まで3時間で昇 温し、同温度で3時間焼成した。焼成後、白色押出し状酸化チタン担体を434 g得た。次いで、この担体50.0gに市販の塩化ルテニウム(RuCl3・n H₂O、Ru含量39.6質量%) 5.78gを純水に溶解して23.5mlと した水溶液を含浸し、室温で3時間放置した。次に、60℃で20分間乾燥した 。次いで、110℃で14時間乾燥した。次いで、得られた固体54.7gを、 室温から300℃まで空気流通下(11/min)、2.0時間で昇温し、同温 度で2時間焼成することにより52.8gの黒色押出し状酸化チタン担持酸化ル テニウム触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2 + TiO_2) \times 100 = 5.65 質量%であった。$

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2) \times 100=4$. 3質量%であった。

このようにして得られた触媒を触媒bとした。

[0095]

実施例2と同様に、EXAFS法によって触媒の動径分布関数のピーク強度比率A(b)を測定した。

動径分布関数の0.32nm付近のピークに対し、触媒bの強度を分子とし、 粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムのピーク強度を分母として、ピーク強度 比率A(b)を求めたところ、値0.49を得た。

[0096]

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒 2.5 gを実施例 1 と同様に反応管に充填し、実施例 1 に準拠して反応を行った。反応開始 1 .8 時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 6 .9 × 1 0 $^{-4}$ m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

[0097]

次に、B(b)を測定するためにテスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の入口から実施例2で使用した触媒と同様の触媒 a 0.25gを希釈剤せずに充填し、触媒 b 2.50gを2mm球の市販のαーアルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)20gとよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192m1/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96m1/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒 b のホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒 b を抜出した。

反応前の触媒 b について E X A F S 法から A (b) を求めたのと同様の方法で、反応後の触媒 b のピーク強度比率 B (b) を求めたところ、値 0 . 6 7 を得た。これらから、B (b) / A (b) = 1 . 3 7 2 3 4 5

[0098]

実施例4

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、STR-60R、100%ルチル結晶系)30.0gと酸化アルミニウム粉末(住

友化学工業(株)AES-12)30.0gをよく混合した。混合したものに純水22.6gと38%酸化チタンゾル(堺化学(株)、CSB)7.9gからなる混合溶液を添加し、混合した。次に室温下に乾燥しながらよく混練した。この混合物を1.5mmφのヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、60℃で2時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタンを得た。得られた固体のうち36.1gを分取し、空気中で、室温から600℃まで1.7時間で昇温し、同温度で3時間焼成し、白色のヌードル状酸化チタン35.4gを得た。焼成後、ヌードル状固体を5mm程度の長さに切り揃えることにより、白色押出し状酸化チタン担体を得た。次いで、この担体30.0gに市販の塩化ルテニウム(RuCl3・nH2O、Ru含量38.2質量%)2.39gと7.00gの純水に溶解して調製した水溶液を含浸し、室温で一晩静置した。次に、60℃で2時間乾燥した。次いで、得られた固体を、室温から350℃まで空気流通下(200m1/min)、1.8時間で昇温し、同温度で2時間焼成することにより31.0gの黒色押出し状酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 /(RuO_2 + TiO_2 + α - Al_2O_3)×100=3.8質量%であった。

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2+\alpha-Al_2O_3)$ × 100=2.9 質量%であった。 このようにして得られた触媒を触媒 b とした。

[0099]

実施例2と同様に、EXAFS法によって触媒の動径分布関数のピーク強度比率A(b)を測定した。

動径分布関数の0.32nm付近のピークに対し、触媒bの強度を分子とし、 粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムのピーク強度を分母として、ピーク強度 比率A(b)を求めたところ、値0.66を得た。

[0100]

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒 2.5 gを実施例 1と同様に反応管に充填し、酸素ガスを 206 m l / m i n で供給し、内温(ホ

ットスポット)を301 C とした以外は、実施例1 に準拠して反応を行った。反応開始2.0 時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 5.15×10^{-4} m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

[0101]

次に、テスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の入口から実施例2で使用した触媒と同様の触媒a0.25gを希釈剤せずに充填し、触媒b2.50gを2mm球の市販のαーアルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)20gとよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192m1/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96m1/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒bのホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒bを抜出した。抜き出した触媒bについて塩素の生成活性を測定した。

すなわち、抜き出した触媒 b 2. 5 g を実施例 1 と同様に反応管に充填し、塩化水素ガスを 1 9 0 m 1 / m i n 供給した以外は実施例 1 に準拠して反応を行った。反応開始 2. 0 時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 4. 1×10^{-4} m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

また、触媒の初期活性と50時間反応後の活性の比はD(b)/C(b)=0.80となった。

[0102]

実施例5

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、STR-60R、100%ルチル結晶系)30.0gと酸化アルミニウム粉末(住友化学工業(株)AES-12)30.0gをよく混合した。混合したものに純水22.5gと38%酸化チタンゾル(堺化学(株)、CSB)7.9gからなる混合溶液を添加し、混合した。次によく混練した。この混合物を1.5mmφのヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、60℃で4時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタンを得た。空気中で、室温から600℃まで1.7時間で昇

温し、同温度で3時間焼成し、白色のヌードル状酸化チタン54.8gを得た。焼成後、ヌードル状固体を5mm程度の長さに切り揃えることにより、白色押出し状酸化チタン担体を得た。次いで、この担体45.0gに市販の塩化ルテニウム(RuCl3・nH2O、Ru含量38.2質量%)3.53gを15.6gの純水に溶解して調製した水溶液を含浸し、室温で一晩静置した。次に、60℃で2時間乾燥した。次いで、得られた固体48.5gのうち21gを、室温から30℃まで空気流通下(200m1/min)、1.5時間で昇温し、同温度で2時間焼成することにより20.2gの黒色押出し状酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2+TiO_2+\alpha-Al_2O_3) × 100=3.8質量%であった。$

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2+\alpha-Al_2O_3)$ × 100=2. 9質量%であった。 このようにして得られた触媒を触媒 b とした。

[0103]

実施例2と同様に、EXAFS法によって触媒の動径分布関数のピーク強度比率A(b)を測定した。

動径分布関数の0.32nm付近のピークに対し、触媒bの強度を分子とし、 粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムのピーク強度を分母として、ピーク強度 比率A(b)を求めたところ、値0.49を得た。

[0104]

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒 2.5 gを実施例 1 と同様に反応管に充填し、塩化水素ガスを193ml/min供給した以外は 実施例1に準拠して反応を行った。反応開始 2.2時間後の時点での単位触媒質 量当りの塩素の生成活性は 5.5×10⁻⁴mol/min·g-触媒であった。

[0105]

次に、テスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の 入口から実施例2で使用した触媒と同様の触媒 a 0. 25 g を希釈剤せずに充填 し、触媒 b 2. 50gを2mm球の市販のα-アルミナ担体 (ニッカトー(株)製、SSA995) 20gとよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192ml/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96ml/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒 b のホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒 b を抜出した。抜き出した触媒 b について塩素の生成活性を測定した。

すなわち、抜き出した触媒 b 2. 5 g を 2 m m 球の市販の α - アルミナ担体 2 O g とよく混合することにより触媒を希釈して石英製反応管に充填した以外は実施例 1 に準拠して反応を行った。反応開始 1 . 8 時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 4 . 5×10^{-4} m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

また、触媒の初期活性と50時間反応後の活性の比はD(b)/C(b)=0 81となった。

[0106]

実施例6

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、STR-60R、100%ルチル結晶系)510gと酸化アルミニウム粉末(住友化学工業(株)AES-12)990gと有機バインダー15gをよく混合した。混合したものに純水371gと38%酸化チタンゾル(堺化学(株)、CSB)197gからなる混合溶液を添加し、混合した。次によく混練した。この混合物を1.5mmゅのヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、110℃で14時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタンを得た。ヌードル状固体を3~5mm程度の長さに切り揃えることにより、白色の酸化チタンを得た。得られた固体のうち450gを分取し、空気中で、室温から600℃まで3.0時間で昇温し、同温度で3時間焼成し、白色の酸化チタン443gを得た。次いで、この担体50.0gに市販の塩化ルテニウム(RuC13・nH2〇、Ru含量39.6質量%)1.96gを純水に溶解して13.4m1とした水溶液を含浸し、室温で3時間放置した。次に、60℃で20分間乾燥した。次いで、110℃で14時

間乾燥した。次いで、得られた固体 5 2. 7 g を、室温から 3 0 0 ℃まで空気流通下(1 1 / m i n)、2. 0時間で昇温し、同温度で 2 時間焼成することにより 5 0. 8 g の黒色押出し状酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 /(RuO_2 + TiO_2 + α - Al_2O_3)×100=2. 0質量%であった。

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2+\alpha-Al_2O_3)$ × 100=1.5質量%であった。 このようにして得られた触媒を触媒 b とした。

[0107]

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒 2.5 g を実施例 1 と同様に反応管に充填し、内温 (ホットスポット) を 2 9 9 ℃とした以外は、 実施例 1 に準拠して反応を行った。反応開始 2.1 時間後の時点での単位触媒質 量当りの塩素の生成活性は 3.83×10⁻⁴mo1/min·g-触媒であった

[0108]

次に、テスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の入口から実施例2で使用した触媒と同様の触媒 a 0. 25 g を希釈剤せずに充填し、触媒 b 2. 50 g を 2 m m 球の市販のαーアルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)20 g とよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192 m 1/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96 m 1/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒 b のホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒 b を抜出した。抜き出した触媒 b について塩素の生成活性を測定した。

すなわち、抜き出した触媒 b 2. 5 g を実施例1と同様に反応管に充填し、塩化水素ガスを190m1/min供給した以外は実施例1に準拠して反応を行った。反応開始2. 0時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は3.

 26×10^{-4} mol/min·g-触媒であった。

また、触媒の初期活性と50時間反応後の活性の比はD(b)/C(b)=0 85となった。

[0109]

比較例1

次の方法により触媒を調製した。すなわち、市販の塩化ルテニウム水和物(RuC13・3H2O、Ru含量35.5質量%)0.70gを純水4.0gに溶解した。水溶液をよく撹拌した後、12~18.5メッシュにそろえ、空気中500℃で1時間乾燥したシリカ(富士シリシア(株)製キャリアクトG-10)5.0gに滴下して加え、塩化ルテニウムを含浸担持した。担持したものを100m1/minの窒素気流下、室温から100℃まで30分で昇温し、同温度で2時間乾燥した後、室温まで放冷し、黒色固体を得た。得られた固体を100m1/minの空気気流下、室温から250℃まで1時間30分で昇温し、同温度で3時間乾燥した後、室温まで放冷し、5.37gの黒色のシリカ担持塩化ルテニウム触媒を得た。なお、ルテニウム含量の計算値は、

Ru/(RuCl $_3$ ・ $_3$ H $_2$ O+SiO $_2$)×100=4.5質量%であった。この様にして得られたシリカ担持塩化ルテニウム触媒2.5gを $_\alpha$ -アルミナ担体で希釈せず、実施例1と同様に反応管に充填し、塩化水素をガスを202m1/min、酸素ガスを213m1/minで流通させたこと以外は実施例1に準拠して反応を行った。反応開始1.7時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は0.49×10 $^{-4}$ mo1/min・gー触媒であった。

[0110]

比較例2

次の方法により触媒を調製した。すなわち、球状酸化チタン(堺化学工業(株)製、CS-300)を乳鉢で粉砕し、粉状にしたもの8.0gと二酸化ルテニウム粉(NEケムキャット(株)製)0.53gとを乳鉢ですりつぶしながらよく混合した後、12~18.5メッシュに成形して、酸化ルテニウム酸化チタン混合触媒を得た。なお、酸化ルテニウム含量の計算値は6.2質量%であった。ルテニウム含量の計算値は4.7質量%であった。

[0111]

比較例3

次の方法により触媒を調製した。すなわち、市販のオルトけい酸テトラエチル41.7gを186m1のエタノールに溶解し、室温で攪拌しながらチタニウムテトライソプロポキシド56.8gを注加し、室温で30分間攪拌した。次に、233m1の純水に酢酸0.14gを溶解することで調製した0.01mo1/1酢酸水溶液にエタノール93m1をよく混合した水溶液を上記溶液に滴下した。滴下するに従って白色の沈殿を生成した。滴下終了後、同じく室温で30分間攪拌した後、攪拌したまま加熱し102℃のオイルバス上で1時間リフラックスさせた。この時の液温は80℃であった。次に、この液を放冷した後グラスフィルターで濾過し、500m1の純水で洗浄し、再度濾過した。この操作を2回繰り返した後、空気中60℃で4時間乾燥し、室温~550℃まで1時間で昇温し同温度で3時間焼成することにより、27.4gの白色な固体を得た。得られた固体を粉砕し、チタニアシリカ粉末を得た。

得られたチタニアシリカ粉末8.0gに市販の塩化ルテニウム水和物(RuC $1_3 \cdot 3H_2O$ 、Ru含量35.5質量%)1.13gを純水8.2gに溶解した液を含浸させた後、空気中60で1時間乾燥し、塩化ルテニウムを担持した。次に担持したものを水素50m1/min、窒素100m1/minの混合気流下、室温から300でまで1時間30分で昇温し、同温度で1時間還元した後、室温まで放冷し、灰褐色のチタニアシリカ担持金属ルテニウム粉末8.4gを得た。

得られたチタニアシリカ担持金属ルテニウム粉末8.4gを100m1/minの空気気流下で、室温から600℃まで3時間20分で昇温し、同温度で3時

間焼成することにより、8.5gの灰色の粉末を得た。得られた粉末を成形し、12~18.5メッシュとすることで、チタニアシリカ担持酸化ルテニウム触媒を得た。なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2+TiO_2+SiO_2)$ ×100=6.2質量%であった。 ルテニウム含量の計算値は、

Ru/(RuO₂+TiO₂+SiO₂) ×100=4. 7質量%であった。

この様にして得られたチタニアシリカ担持酸化ルテニウム触媒 2.5 gを α -アルミナ担体で希釈せず、実施例 1 と同様に反応管に充填し、塩化水素ガスを 1 8 0 m 1 / m i n、酸素ガスを 1 8 0 m 1 / m i n、酸素ガスを 1 8 0 m 1 / m i nで流通させた以外は実施例 1 の反応方法に準拠して行った。反応開始 1 8 時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 0 .4 6 × 1 0 -4 m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

[0112]

比較例4

次の方法により触媒を調製した。すなわち、1~2mmφの球形の酸化チタン担体(堺化学工業製、CS-300S-12)10.1gに、あらかじめ市販の塩化ルテニウム(RuCl3・nH2O、Ru含量37.3質量%)1.34gを3.7gの純水に溶解して調製した水溶液を含浸し、次に、空気中60℃で4時間乾燥した。黒褐色の固体が得られた。この固体を水素還元するために、水素(20m1/min)と窒素(200m1/min)の混合気流下室温から250℃まで2時間で昇温し、同温度で8時間還元した。還元後、10.3gの黒色固体が得られた。次に、得られた固体を空気中で350℃まで1時間で昇温し、同温度で3時間焼成した。10.6gの黒色の酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒が得られた。なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2+TiO_2) \times 100=6$. 1質量%であった。 ルテニウム含量の計算値は、

Ru/(RuO₂+TiO₂)×100=4.7質量%であった。

この様にして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒 2.5 g と $1\sim 2$ m ϕ の球状の酸化チタン(CS-300S-12 堺化学工業(株)) 5 g をよく混合することにより触媒を希釈し、を実施例 1 と同様に反応管に充填し、塩化水素

ガスを187m1/min、酸素ガスを199m1/minで流通させた以外は実施例1に準拠して行った。反応開始2.0時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は $2.89\times10^{-4}mo1/min\cdot g$ ー触媒であった。

[0113]

比較例5

次の方法により触媒を調製した。すなわち、1~2mmφの球形の5質量%担持金属ルテニウム酸化チタン触媒10.0g(N.E.ケムキャット社製)に、0.5mo1/1塩化カリウム水溶液を触媒の表面に水が浮き出るまで含浸した後、空気中60℃で、1時間乾燥した。この操作を2回繰り返した。塩化カリウム水溶液の含浸量は1回目3.31g、2回目3.24gで合計は6.55gであった。塩化カリウムとルテニウムのモル比の計算値は0.66であった。乾燥したものを空気中で350℃まで1時間で昇温し、同温度で3時間焼成した。次に、得られた固体を500m1の純水で30分間洗浄し濾別した。この操作を5回繰り返した。濾液に硝酸銀水溶液を滴下して、塩化カリウムが残存していないことを確認した。洗浄した後、固体を60℃で4時間乾燥して、黒色の球状酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒9.9gが得られた。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 /(RuO₂+TiO₂)×100=6.6質量%であった。

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2) \times 100=5.0 質量%であった。$

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒 2.5 gと1~2 mm φ の球状の酸化チタン(CS-300S-12 堺化学工業(株))5 gをよく混合することにより触媒を希釈し、実施例1と同様に反応管に充填し、塩化水素ガスを187m1/min、酸素ガスを199m1/minで流通させた以外は実施例1の反応方法に準拠して行った。反応開始 2.0時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 4.03×10⁻⁴mo1/min・gー触媒であった。

[0114]

比較例6

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、S TR-60R、100%ルチル結晶系) 50. 0gに純水35. 1gと酸化チタ ンゾル (堺化学(株)CSB, TiO2含量38質量%) 6.6gを加え混練した 。この混合物を1.5mmφのヌードル状に押出し成型した。次いで、空気中、 60℃で2時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタン40.2gを得た。この操 作同様の操作を行い、合計80.7gの白色のヌードル状酸化チタンを得た。得 られた固体を空気中で、室温から700℃まで1.9時間で昇温し、同温度で3 時間焼成し、白色のヌードル状酸化チタンを得た。焼成後、ヌードル状固体を5 mm程度の長さに切り揃えることにより、白色押出し状酸化チタン担体を得た。 次いで、この担体 20.0gに市販の塩化ルテニウム(RuCl $_3$ ・ $_1$ H $_2$ O、R u含量37.3質量%) 2.55gを8.65gの純水に溶解して調製した水溶 液を含浸し、60℃で2時間乾燥した。次いで、得られた固体を2N水酸化カリ ウム溶液13.2gと純水120g、ヒドラジン1水和物3.21gからなる溶 液中に浸した。浸すと同時に発泡が起きた。60分後、上澄液を濾別により除去 した。ついで、得られた固体に500mlの純水を加えて、30分間洗浄した後 、濾別した。この操作を5回くりかえした。この時の1回目の洗浄液のpHは9 . O、5回目の洗浄液のpHは6.3であった。濾別した固体に0.5mol/ 1塩化カリウム溶液50gを加えて撹拌した後に再び固体を濾別した。この操作 を3回繰り返した。得られた固体を60℃で4時間乾燥し、21.0gの黒色固 体を得た。次いで、空気中で、室温から350℃まで1時間で昇温し、同温度で 3時間焼成し20.5gの黒色固体を得た。焼成後、500m1の純水を加えて 攪拌した後、固体を濾別した。この操作を5回繰り返し、洗液に硝酸銀水溶液を **滴下し、塩化カリウムの残存していないことを確認した。次いで、この固体を 6** ○℃で4時間乾燥することにより、黒色押出し状酸化チタン担持酸化ルテニウム 触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 /(RuO₂+TiO₂)×100=5.9質量%であった。 ルテニウム含量の計算値は、

Ru/(RuO₂+TiO₂)×100=4.5質量%であった。

[0115]

実施例2と同様に、EXAFS法によって触媒の動径分布関数のピーク強度比率A(b)を測定した。

動径分布関数の0.32nm付近のピークに対し、触媒bの強度を分子とし、 粒子径10nm以上の二酸化ルテニウムのピーク強度を分母として、ピーク強度 比率A(b)を求めたところ、値0.41を得た。

[0116]

次に、B(b)を測定するためにテスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の入口から実施例2で使用した触媒と同様の触媒a0.25gを希釈剤せずに充填し、触媒b2.50gを2mm球の市販のαーアルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)20gとよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192ml/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96ml/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒bのホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒bを抜出した。抜き出した触媒bについて塩素の生成活性を測定した。

すなわち、抜き出した触媒 b 2. 5 g を実施例 1 と同様に反応管に充填し、 2 mm球の市販の α - アルミナ担体 2 0 g とよく混合することにより触媒を希釈して石英製反応管に充填した以外は実施例 1 に準拠して反応を行った。反応開始 2 . 0 時間後の時点での単位触媒質量当りの塩素の生成活性は 6 . 5×1 0^{-4} m o 1 / m i n · g - 触媒であった。

また、触媒の初期活性と50時間反応後の活性の比はD(b)/C(b)=0.74となった。

[0117]

比較例7

次の方法により触媒を調製した。すなわち、酸化チタン粉末(堺化学(株)、S TR-60R、100%ルチル結晶系)25.0gと酸化アルミニウム粉末(住 友化学工業(株) AL-31) 25. 0gをよく混合した。混合したものに純水 18.9gと酸化チタンゾル (堺化学(株)CSB, TiO2含量38質量%) 6 . 6gを加え混練した。この混合物を1.5mmφのヌードル状に押出し成型し た。次いで、空気中、60℃で2時間乾燥し、白色のヌードル状酸化チタン47 1gを得た。得られた固体のうち24.5gを分取し、空気中で、室温から6 00℃まで1.7時間で昇温し、同温度で3時間焼成し、白色のヌードル状酸化 チタンを得た。焼成後、ヌードル状固体を5mm程度の長さに切り揃えることに より、白色押出し状酸化チタン担体を得た。次いで、この担体20.0gに市販 の塩化ルテニウム (RuCl₃·nH₂O、Ru含量37.3質量%) 0.805 gを5.82gの純水に溶解して調製した水溶液を含浸し、60℃で2時間乾燥 した。乾燥したものを2N水酸化カリウム溶液4.2gと純水120g、ヒドラ ジン1水和物1.03gからなる溶液中に浸した。浸すと同時に発泡が起きた。 60分後、上澄液を濾別により除去した。ついで、得られた固体に500mlの 純水を加えて、30分間洗浄した後、濾別した。この操作を5回くりかえした。 この時の1回目の洗浄液のpHは9.0、5回目の洗浄液のpHは6.5であっ た。濾別した固体に0.5mo1/1塩化カリウム溶液50gを加えて撹拌した 後に再び固体を濾別した。この操作を3回繰り返した。得られた固体を60℃で 4時間乾燥し、黒色固体を得た。次いで、空気中で、室温から350℃まで1時 間で昇温し、同温度で3時間焼成し黒色固体を得た。焼成後、500mlの純水 を加えて攪拌した後、固体を濾別した。この操作を5回繰り返し、洗液に硝酸銀 水溶液を滴下し、塩化カリウムの残存していないことを確認した。次いで、この 固体を60℃で4時間乾燥することにより、20.2gの黒色押出し状酸化チタ ン担持酸化ルテニウム触媒を得た。

なお、酸化ルテニウム含量の計算値は、

 RuO_2 / $(RuO_2+TiO_2+\alpha-Al_2O_3) × 100=1$. 9質量%であった。

ルテニウム含量の計算値は、

 $Ru/(RuO_2+TiO_2+\alpha-Al_2O_3) \times 100=1$. 5質量%であった。

[0118]

このようにして得られた酸化チタン担持酸化ルテニウム触媒2.5gを実施例1と同様に反応管に充填し、実施例1に準拠して反応を行った。

[0119]

次に、テスト反応を行った。すなわち石英反応管(内径14mm)に反応管の入口から実施例2で使用した触媒と同様の触媒a0.25gを希釈剤せずに充填し、触媒b2.50gを2mm球の市販のαーアルミナ担体(ニッカトー(株)製、SSA995)20gとよく混合することにより触媒を希釈して充填した。塩化水素ガスを192m1/min(0.51モル/hr)、酸素ガスを96m1/min(0.26モル/hr)(いずれも0℃、1気圧換算)常圧下に供給した。石英反応管を電気炉で加熱し、触媒層の温度を320~360±1℃の範囲とし、触媒bのホットスポットを360±1℃とした。以上の条件で50時間反応を継続した後、触媒bを抜出した。抜き出した触媒bについて塩素の生成活性を測定した。

すなわち、抜き出した触媒 b 2. 5 g を実施例 1 と同様に反応管に充填し、実施例 1 に準拠して反応を行った。

[0120]

【発明の効果】

以上説明したとおり、本発明により、担持酸化ルテニウム触媒の製造方法であって、活性の高く、より少量の触媒でより低い反応温度で目的物質を製造可能な、また、触媒の活性低下の少ない、担持酸化ルテニウム触媒が提供でき、塩化水素を酸素によって酸化する塩素の有利な製造等に寄与する。

【書類名】

要約書

【要約】

【課題】より少量の触媒でより低い反応温度で、塩化水素を酸素によって酸化する塩素の製造等の目的物質を製造できる活性の高い、また反応中にシンタリングの少ない、かつ、調製工程が簡便であり、触媒活性低下の少ない担持酸化ルテニウム触媒の製造方法を提供する。

【解決手段】ルテニウム化合物を触媒担体に担持後、焼成して得られるものを、ヒドラジン処理して酸化するか、ヒドラジン処理せずに、広域X線吸収微細構造解析(EXAFS)法にて測定した値が特定の条件を充足した時、もしくは担体にルチル結晶形を含有する酸化チタンを用いた該触媒を用いてその触媒を特定の触媒活性試験方法にて測定した値が特定の条件を充足した時に優れた触媒が得られる。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2000-206304

受付番号

50000855680

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0095

作成日

平成12年 7月12日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000002093

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

【氏名又は名称】

住友化学工業株式会社

【代理人】

申請人

【識別番号】

100093285

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友

化学工業株式会社内

【氏名又は名称】

久保山 隆

【選任した代理人】

【識別番号】

100094477

【住所又は居所】

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友

化学工業株式会社内

【氏名又は名称】

神野 直美

【選任した代理人】

【識別番号】

100113000

【住所又は居所】

大阪市中央区北浜4丁目5番33号 住友化学工

業株式会社内

【氏名又は名称】

中山 亨



出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名 住友化学工業株式会社